

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ  $p$ -InAs $\langle$ Mn $\rangle$ 

Георгицэ Е. И., Постолаки И. Т., Смирнов В. А., Унтила П. Г.

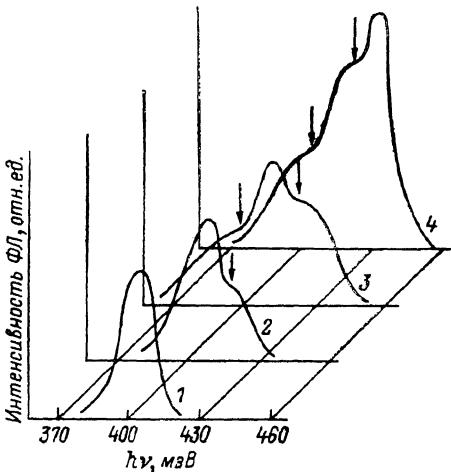
Исследованию излучательной рекомбинации арсенида индия и твердых растворов на его основе посвящено значительное число работ [1-5]. В большинстве из них приведены результаты исследования спектров фотолюминесценции (ФЛ) арсенида индия  $n$ -типа.

В настоящем сообщении представлены некоторые результаты исследования спектров ФЛ  $p$ -InAs, легированного марганцем, при 77 и 4.2 К.

Монокристаллические образцы InAs $\langle$ Mn $\rangle$  с содержанием марганца в диапазоне  $8 \cdot 10^{16}$ – $3 \cdot 10^{18}$  см $^{-3}$  были выращены методом Бриджмена. На полученных образцах были произведены измерения коэффициента Холла, проводимости.

Известно, что марганец в арсениде индия обладает стабильной валентностью +2 и является однозарядным акцептором [1, 2]. Все исследованные нами образцы арсенида индия, легированного марганцем, имели при 300 К дырочную проводимость.

Перед измерением спектра ФЛ образцы травились в полирующим травителе (Br : бутанол). Спектры ФЛ изменились по импульсной методике. Неравновесные носители возбуждались



Спектры ФЛ для InAs при 77 (1–3) и 4.2 К (4). Концентрация, см $^{-3}$ : 1 –  $8 \cdot 10^{16}$ , 2 –  $2 \cdot 10^{17}$ , 3, 4 –  $3 \cdot 10^{18}$ .

с помощью полупроводникового гетеролазера на основе  $Ga_xAl_{1-x}As$ . Сигнал ФЛ на выходе монохроматора МДР-23 регистрировался фотоприемником Ge<math>\langle Au \rangle.

На рисунке приведены экспериментальные результаты измерения спектров ФЛ арсенида индия для трех степеней легирования. Спектр рекомбинационного излучения InAs с малой концентрацией марганца при 77 К состоит из одной полосы (кривая 1).

Экспериментально обнаружено, что при увеличении содержания марганца полуширина наблюдаемой линии ФЛ увеличивается, а ее максимум смещается в коротковолновую область спектра. Кроме того, начиная с концентрации марганца  $2 \cdot 10^{17}$  см $^{-3}$  при 77 К в спектре ФЛ появляется дополнительная линия (кривая 2). Максимум второго пика находится на энергетическом расстоянии ~30 мэВ от основного пика. Полученные значения для энергии активации акцептора согласуются с данными работы [3].

Для образца с концентрацией марганца  $3 \cdot 10^{18}$  см $^{-3}$  был измерен спектр ФЛ при 4.2 К (кривая 4). Из представленного спектра видно, что при более низких температурах интенсивность коротковолновой полосы существенно увеличивается и появляется особенность в длинноволновом крыле спектра ФЛ.

Исследования температурной зависимости интенсивности фотолюминесценции позволяют предположить, что при температурах ниже 25 К коротковолновая полоса связана с излучательными переходами с участием мелких доноров и акцепторов, а при более высоких температурах ( $T > 30$  К) данная полоса соответствует межзонным переходам. Средняя полоса (кривая 3), по-видимому, связана с переходами зона проводимости—акцептор. Особенности длинноволновой области спектра ФЛ связаны, очевидно, с донорно-акцепторной рекомбинацией [4].

# Л и т е р а т у р а

- [1] Мастеров В. Ф. // ФТП. 1984. Т. 18. В. 1. С. 3—23.
- [2] Мастеров В. Ф., Саморуков Б. Е. // ФТП. 1978. Т. 12. В. 4. С. 625—652.
- [3] Андрианов Д. Г., Карагаев В. В., Лазарева Г. В., Муравлев Ю. Б., Савельев А. С. // ФТП. 1977. Т. 11. В. 7. С. 1252—1259.
- [4] Георгицэ Е. И., Постолаки И. Т., Смирнов В. А., Унтила П. Г., Юлдашев Ш. У. // Материалы для полупроводниковой электроники. Кишинев, 1986. С. 155—159.
- [5] Зотова Н. В., Карапашев С. А., Матвеев Б. А., Стусь Н. М., Талалакин Г. Н., Билинец Ю. Ю. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 6. С. 1079—1084.

Тираспольский государственный  
педагогический институт  
им. Т. Г. Шевченко

Получено 6.10.1988  
Принято к печати 7.12.1988

*ФТП, том 23, вып. 4, 1989*

## КЛАСТЕРНЫЙ РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ЗАРЯДОВ ДЕФЕКТОВ В КРЕМНИИ

Грехов А. М., Кустов В. Е., Трипачко Н. А., Шаховцов В. И.

Введение дефектов (примесей, термических и радиационных дефектов) приводит к образованию в монокристалле деформационных полей. Экспериментальное и теоретическое определение характеристик полей внутренних упругих напряжений является актуальной задачей физики твердого тела [1, 2]. Значительный интерес представляет эта проблема в случае монокристаллического кремния. Для этого материала был предложен метод парамагнитных тензозондов (МПТЗ) [3, 4], позволяющий с достаточной точностью определять величину деформационного заряда различных дефектов. Кроме того, для кремния проведено значительное количество рентгеновских измерений изменения параметра решетки при введении примесей, например кислорода [5], углерода [6, 7], герmania [7, 8] и др.

Цель настоящей работы — оценка деформационных зарядов дефектов в кремнии на основе кластерных квантово-химических расчетов и сравнение полученных результатов с экспериментом.

Величина деформационного заряда дефекта ( $A$ ) в приближении упругого континуума с учетом сил поверхностного натяжения в кубическом кристалле имеет вид [2]

$$A = \frac{\Delta V}{4\pi} \frac{1 + \nu}{1 - \nu} \frac{C_{11}}{C_{11} + 2C_{12}},$$

где  $\nu$  — коэффициент Пуассона,  $C_{11}$  и  $C_{12}$  — постоянные упругой жесткости,  $\Delta V$  — изменение объема кристалла при введении одного дефекта данного типа. Таким образом, расчет деформационного заряда дефекта сводится к вычислению величины  $\Delta V$ . Эта задача решается с использованием кластерного подхода, в котором фрагмент структуры реального кристалла моделируется кластером промежуточного размера. При этом кластер, содержащий 15—30 атомов, в том числе интересующие нас дефекты и их ближайшие соседи, извлекается из решетки и рассматривается как большая молекула. Геометрические конфигурации связей атомов кластера определяются обычными требованиями к валентной связи для данного типа атомов и из условия минимизации полной энергии кластера.

На начальном этапе исследований выбраны односферный  $[SiSi_4H_{12}]$  и двухсферный  $[SiSi_4Si_{12}H_{36}]$  кластеры, в которых роль граничных условий играют атомы водорода, насыщающие оборванные связи. На первый взгляд, выбор кластеров таких размеров для рассмотрения дальнодействующей деформации, связанной с наличием дефектов, может показаться недостаточно обоснованным.